



Conclusions des journées Plasmas-photovoltaïque 8 et 9 novembre 2010

Définition de projets (les équipes caractérisation sont incluses dans tous les projets) :

1) TCO et antireflet pour c-Si ; nanostructure, SnO₂, ZnO, TCO innovants pour RCC, HIT, Couches minces, CIGS.

Mise en place d'un réseau coordonné par Patricia Prod'homme (LPICM) et Mehrad Nikravetch (LIMHP)

Mise en place d'un projet TCO pour HIT par Delfina Munoz (INES)

2) c-Si ; tout voie sèche

Coordonnateurs : Nam Le Quang (Photowatt) et Françoise Massines (PROMES)

Antireflet texturation plasma/laser, amélioration Absorption dans Si-mc

TEXTU homogène + nettoyage des défauts (passivation) + passivation + émetteur + face arrière

3) Sources plasmas pour Si: faire vite et bien, couches minces silicium, croissance homogène, action sur la surface, hydrogène, précurseur.

Coordonateur : Pere Roca (LPICM)

4) CIGS , plasmionique

5) Nanomatériaux dans le PV ? Journées à Marseille organisées par Bernard Fontaine + Marcel Pasquellini (ou quelqu'un du labo)

5) Groupe de travail-réseau plasmas froids : besoin en PV : mis en place par Richard Clergereaux (LAPLACE) et Eric Tomasella (LMI)

Contribution de Pere: demande auprès de contacts dans les différentes filières PV d'envoyer les infos aux coordonnateurs